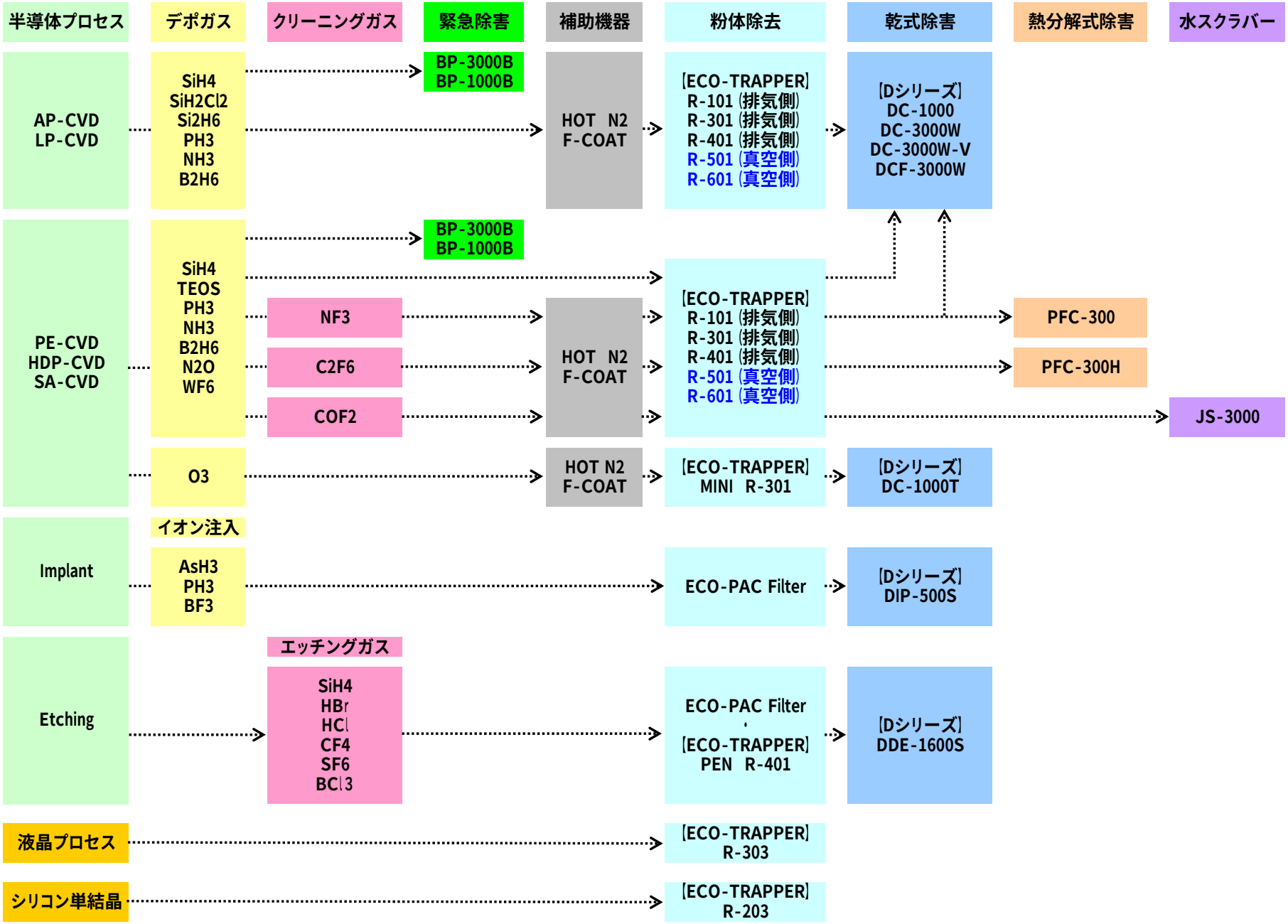
製品ラインアップ


半導体プロセス
デポガス
クリーニングガス
緊急除害
補助機器
粉体除去
乾式除害
熱分解式除害
水スクラバー
AP-CVD
LP-CVD
SiH4
SiH2Cl2
Si2H6
PH3
NH3
B2H6
BP-3000B
BP-1000B
HOT N2
F-COAT
[ECO-TRAPPER]
R-101 (排気側)
R-301 (排気側)
R-401 (排気側)
R-501 (真空側)
R-601 (真空側)
[Dシリーズ]
DC-1000
DC-3000W
DC-3000W-V
DCF-3000W
PE-CVD
HDP-CVD
SA-CVD
SiH4
TEOS
PH3
NH3
B2H6
N2O
WF6
BP-3000B
BP-1000B
NF3
C2F6
COF2
HOT N2
F-COAT
[ECO-TRAPPER]
R-101 (排気側)
R-301 (排気側)
R-401 (排気側)
R-501 (真空側)
R-601 (真空側)
PFC-300
PFC-300H
JS-3000
O3
HOT N2
F-COAT
[ECO-TRAPPER]
MINI R-301
[Dシリーズ]
DC-1000T
Implant
イオン注入
AsH3
PH3
BF3
ECO-PAC Filter
[Dシリーズ]
DIP-500S
Etching
エッチングガス
SiH4
HBr
HCl
CF4
SF6
BCl3
ECO-PAC Filter
・
[ECO-TRAPPER]
PEN R-401
[Dシリーズ]
DDE-1600S
液晶プロセス
[ECO-TRAPPER]
R-303
シリコン単結晶
[ECO-TRAPPER]
R-203